

Priority from

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平3-202269

⑬ Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成3年(1991)9月4日

B 24 B 37/00
C 09 G 1/00
C 09 K 3/14
H 01 L 21/304H
X
P
3 2 16581-3C
6516-4H
7043-4H
8831-5F

審査請求 未請求 請求項の数 42 (全9頁)

⑮ 発明の名称 低ナトリウム低金属シリカ研磨スラリー

⑯ 特 願 平2-129345

⑰ 出 願 平2(1990)5月21日

優先権主張 ⑱ 1989年10月12日 ⑲ 米国(US) ⑳ 420786

⑳ 発 明 者 ジョン エイ. ロムバード アメリカ合衆国, イリノイ 60304, オーク パーク, サウス ロムバード アベニュー 741

㉑ 発 明 者 チャールズ シー. ベイン アメリカ合衆国, イリノイ 60504, オーロラ, リッジロード 2545

㉒ 出 願 人 ナルコ ケミカル カンパニー アメリカ合衆国, イリノイ 60563-1198, ネイバービル, ワン ナルコ センター (番地なし)

㉓ 代 理 人 弁理士 青 木 朗 外3名

明 細 書

1. 発明の名称

低ナトリウム低金属シリカ研磨スラリー

2. 特許請求の範囲

1. (i) シリカ基準で約0~200ppmのナトリウム及び金属含有量を有するコロイド状シリカ、
(ii) 殺細菌剤及び(iii) 殺生物剤を含んで成るコロイド状シリカスラリー。

2. 該コロイド状シリカがシリカ基準で約0~100ppmのナトリウム及び金属含有量を有する請求項1記載のコロイド状シリカスラリー。

3. 該コロイド状シリカがシリカ基準で約0~100ppmのアニオン含有量を有する請求項1記載のコロイド状シリカスラリー。

4. 該コロイド状シリカがアンモニア、アミン類及び第四級アンモニウム塩の群から選択された少なくとも1種の対イオンを含む請求項1記載のコロイド状シリカスラリー。

5. 該コロイド状シリカが、脱イオン化され、次いで水酸化アンモニウム及び/又は炭酸アンモ

ニウムで再アルカリ化された、標準ナトリウムベースのシリカゾルである請求項1記載のコロイド状シリカスラリー。

6. 該コロイド状シリカがシリケートエステル、テトラハロゲン化炭素及びその他の高純度シリカ源の群から選択された少なくとも1種の化合物から製造された低ナトリウム低金属シリカゾルである請求項1記載のコロイド状シリカスラリー。

7. 該コロイド状シリカが約1~60%の範囲の量で存在し、該殺細菌剤が約0.08~5%の範囲の量で存在し、そして該殺生物剤が約0~1000ppmの範囲の量で存在する請求項1記載のコロイド状シリカスラリー。

8. 該殺細菌剤が約0.1~1.25%の範囲の量で存在する請求項7記載のコロイド状シリカスラリー。

9. 該殺生物剤が約0.5~0.75%の範囲の量で存在する請求項8記載のコロイド状シリカスラリー。

10. 該殺生物剤が約65~100ppmの範囲の量で存